Sm/Fe 薄膜における Sm 3d XPS スペクトルの膜厚及び温度依存性

奥 沢 誠・飯 島 千 尋・芹 澤 嘉 彦
群馬大学教育学部物理学教室
(2010 年 9 月 24 日受理)

Dependence of the Sm 3d XPS spectra on the thickness and temperature in Sm/Fe thin films

Makoto OKUSAWA, Chihiro IIJIMA and Yoshihiko SERIZAWA

Department of Physics, Faculty of Education, Gunma University, Maebashi, Gunma 371-8510, Japan (Accepted on September 24th, 2010)

Abstract

Analysis has been carried out for the Sm $3d_{5/2}$ XPS spectra in Sm(d nm) /Fe(10.0nm) films (d=0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0, 10.0) deposited on a deposited Fe film. Dependence of the spectra on the thickness and temperature is reported. Little diversity was seen in the spectral shape of the Sm $3d_{5/2}$ spectra at both 16K and room temperature, average valence of Sm atom being 2.7, in the thickness range of 2.0-10.0nm. Taking account of an inelastic mean-free-path of about 0.8nm in the Sm film, this implies that some interaction between the Sm atom and the Fe atom in the substrate extends to 0.5-1.0nm from the interface. The thickness range of 0.3-1.5nm. In the thickness of 0.3nm corresponding to Sm monolayer, the average valence of the Sm atom could increase with cooling from room temperature to 16K.

1 序

薄膜は、科学的興味や技術的応用の両面から非常 に注目されており、特に磁性薄膜は、様々な系にお いて多くの研究が行われている。この中でも、希土 類金属と遷移金属とを組み合わせた RE/TM (RE: 希土類金属、TM:遷移金属)系薄膜は特異な磁気的 性質を持つことなどから、ことに関心が高い。

RE/TM 系多層薄膜はある条件で垂直磁化膜となり、その垂直磁気異方性の磁気特性は超高密度記録

媒体として応用的な価値が高いため、この薄膜について多くの開発研究がなされている。最近、Co/Pt ナノ多層膜について、磁気コンプトンプロファイルの 異方性から、Coの垂直磁気異方性が Co 3d の磁気 量子数に大きく依存することが示された¹⁾。しか し、磁気コンプトン散乱による磁性薄膜の研究は緒 についたところであり、RE/TM 系多層薄膜の磁気 異方性を形成する電子状態の研究は僅少である。

本研究では多層薄膜の基礎的知見を得るために、 多層ではなく繰返しのない単一の薄膜を対象とし た。また、本研究の目的は、RE/TM 系薄膜である Sm/Fe 薄膜の Sm 3d 準位 XPS の論文²⁾の考察を進 展させ、論文 2 では考慮しなかった、多重項構造と 遷移確率を取り入れた議論を行い、Sm/Fe 薄膜にお ける電子状態の膜厚依存性に加え、温度依存性に関 する知見を得ることである。

本論文では、第2章で(希土類金属)/(遷移金属) 薄膜の先行研究について纏め、第3章で結果の解析 を行い、第4章では考察と結論を記す。

2 (希土類金属)/(遷移金属)薄膜

Sm は中性原子では 4f⁶(5s²5p⁶)6s² 電子配置を持 つが、金属ではバルクで Sm³⁺、表面で Sm²⁺ の電子 配置を取る³⁾ ことが知られている。

Sm 薄膜に関しても一般的には、表面層が Sm²⁺、 その他のより内部は Sm³⁺ の電子配置であると考え られている。Sm/(金属)薄膜については、 Sm/Al(111)⁴⁾, Sm/Al(001)⁵⁾, Sm/Cu(001)⁶⁾, Sm/Mo(110)⁷⁾ などが研究されている。また、論文 2 と同じ手法である、Sm の膜厚を変化させ、Sm 3d 光 電子スペクトルを液体窒素温度で測定した研究が散 見され、対象の試料は Sm/Si(001)⁸⁾, Sm/Al(001)⁵⁾, Sm/Cu(001)⁶⁾ である。

本研究のテーマである Sm/Fe 薄膜については過 去に、E. Vescovo らによって Sm/Fe(100) について 研究されている⁹⁾。その研究では、Fe(100)上の Sm の膜厚を変化させ、4f 電子のスピン分解光電子分光 等の測定が室温で行われ、Sm²⁺ と Sm³⁺の存在比、 界面付近の磁気秩序が示された。また、Sm³⁺ スペク トルの結合エネルギーシフトが見られた。2 原子層 以下でのシフト量が大きく、それ以上では飽和する ことが観測されている。

3 Sm 3d_{5/2} 準位線の解析

図1に16K、図2に室温におけるSm(dnm)/ Fe(10.0nm)/(ステンレス基板)(d=0.0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0, 10.0) 薄膜のSm 3d XPS スペクト ルを示す。これらは、論文2から引用した図にa, b,



図1 16K における Sm(*d* nm)/Fe(10.0nm)の Sm 3*d* XPS スペクトル²⁾。*d* = (0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0, 10.0)。縦線 a, b, c については本文参照。

cで示された3本の線が挿入されたものである。用 いた試料からは Ols 準位線が観測されなかったこ と、Sm酸化物の試料のSm 3d5/2 準位線のエネル ギー位置は c 点より 0.7eV 程度高エネルギー側に位 置していることから、図中の構造が酸化物によるも のではないことを確認してある。a, b, c はそれぞれ 2.0nm 以上の膜厚の薄膜における Sm²⁺ 3d_{5/2} 準位線 の重みが最も大きい多重項構造、Sm³⁺3d_{5/2}準位線 の重みが最も大きい多重項構造、及び重みが次に大 きい多重項構造の結合エネルギー値を表している。 a, b, c に対応する多重項構造の相対的エネルギー値 は物質より幾分異なっている10)。論文2では、多重 項構造と遷移確率を考慮しない範囲の解析と考察を 行ったが、ここではこれらを含めて議論する。ただ し、多重項構造は Sm²⁺ 及び Sm³⁺ の 3d_{5/2} 準位線共 に数 eV に亘って分布しているが、ここではスペク トル形状に主要な影響を与える上記の多重項構造の みを考慮する。また、Sm 3d_{3/2} 準位線は Sm 3d_{5/2} 準

位線より強度が弱い上、Sm $3d_{5/2}$ 準位線と同様な依存性を示すため、ここでは議論しない。

図1から16Kでは、膜厚2.0nm-10.0nmのスペ クトルの形状には大きな差異が見られない。一方、 0.3nm-1.5nmのスペクトルの形状には大きな差異 があることが認められ、膜厚 2.0nm から膜厚が減少 すると共に強度が b 点から c 点に移動しているのが 見て取れる。a, b, c で示されるエネルギー値でのス ペクトル強度変化の概要を得るために、非弾性散乱 によるバックグラウンドを直線で粗く近似し、各エ ネルギー値での強度を表1に示す。表1(a)は16K、 表1(b)は室温の値である。また、強度は同一スペク トル内での a 点 (Sm²⁺ 成分) に対する b、c 点 (Sm³⁺ 成分)の強度 (b/a、c/a) 及び両点の強度の和 ((b+ c)/a) である。表1(a)の強度比は、図1で見て取れ る傾向と対応していることが分かる。すなわち、c/a の強度は、b/aの強度と比較して、膜厚 2.0nm-10.0nm で大きな変化がないが、膜厚 2.0nm から膜厚 が減少すると共に増大している。

図2と表1(b)から常温においても膜厚2.0nm-10.0nmでは、形状に大きな差異は見られないが、 2.0nm以下の膜厚では形状が大きく変化しているこ とが分かる。ただし、膜厚2.0nm以下の変異の傾向 は、16Kのものと異なっている。膜厚2.0nmから膜 厚が減少すると共に重みがb点からc点に移動して いき、膜厚0.7nmでc点の強度が最大になり、その 後は再びb点の重みが増してくる。 同じ膜厚の16Kと室温でのスペクトルの形状を比較する。まず図1と図2との比較より、膜厚2.0nm-10.0nmでは、二つの温度間で形状の明確な差異は見られない。このことから、2.0nm以上の膜厚では膜厚依存性も温度依存性も観測されなかったといってよ



- 図2 室温におけるSm(d nm)/Fe(10.0nm)の Sm 3d XPS スペクトル²⁾。d=(0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0, 10.0)。縦線 a, b, c については本文 参照。
- 表1 a, b, c で示されるエネルギー位置でのスペクトル強度。(a)は 16K、(b)は室温での値。強度は同一スペクト ル内での a 点(Sm²⁺成分)に対する b、c 点(Sm³⁺成分)での強度(b/a、c/a)及び両点での強度の和((b+ c)/a)である。

膜厚 [nm]	(a) 16K			(b) R.T.		
	c/a	b/a	(c+b)/a	c/a	b/a	(c+b)/a
10.0	1.2	1.7	2.9	1.7	1.9	3.6
5.0	1.3	1.7	3.0	1.6	1.7	3.3
2.0	1.2	1.7	2.9	1.7	1.7	3.4
1.5	1.5	1.7	3.2	2.1	1.9	4.0
1.0	1.3	1.6	2.9	1.9	1.7	3.6
0.7	1.5	1.6	3.1	3.1	2.4	5.5
0.5	1.5	1.6	3.1	2.1	1.8	3.9
0.3	1.9	1.4	3.3	1.3	1.4	2.7

い。2.0nm 以下の膜厚では 16K と室温で形状の膜厚 依存性が異なっていた。同じ膜厚の16Kと室温での スペクトルの形状間の差異が大きいのは、前述の結 果から、膜厚 0.7nm と 0.3nm 近辺であると推測され る。そこで、これらの膜厚における二つの温度での スペクトル形状を比較する。図3は、16Kと室温の Sm 薄膜の Sm 3d_{5/2} 準位線スペクトルであり、(a)は Sm(0.7)/Fe(10.0), (b) $\& Sm(0.3)/Fe(10.0) \oplus \mathbb{Z}^{\sim}$ クトルである。バックグランドの処理、強度の規格 化の方法は表1を作成した時と同様である。図から 分かるように、Sm³⁺準位線は主ピークの位置が温 度、膜厚によって移動するため、これを強度の基準 にするには無理があるので、形状の変化しない Sm²⁺ 3d_{5/2} 準位線を基準に採用した。図 3(a)は、膜 厚が 0.7nm の Sm 薄膜では、室温から 16K に降温す ると、Sm³⁺ 3d_{5/2} 準位線の重みが大きく減少すると 同時に、ピーク位置がc点からcとbの中間の点に 移っていることを示している。また、図 3(b)は、膜 厚が 0.3nm の Sm 薄膜では、室温から 16K に降温す ると、0.7nmの薄膜とは対照的に Sm³⁺ 3d_{5/2} 準位線 の重みが増加すると同時に、ピーク位置がbよりの 点からc点に移っていることを示している。膜厚 0.3nmのSm薄膜において、Sm²⁺3d_{5/2}準位線の重 みが大きいのは、0.3nmの薄膜中で bulk の領域が減 少し Sm²⁺ イオンが占める領域が相対的に増加した ことによると推測される。

4 考察

本研究では Sm(d nm)/Fe(10.0nm)の Sm 3 $d_{5/2}$ 準 位線について以下の解析結果が得られた。

- 2.0 ≤ d ≤ 10.0 の膜厚の領域では、16K、室温 を問わず Sm 3d_{5/2} 準位線の形状に大きな差異 は見られなかった。
- ② $0.3 \le d \le 2.0$ の膜厚の領域では、Smの膜厚 の減少に伴い、Sm³⁺ $3d_{5/2}$ 線の重みが次の振舞 いを示す: (a) 16K では単調に高結合エネル ギー側に移動する。(b)室温では一旦高結合エ ネルギー側に移動し、0.7nm で最大になり、その 後低結合エネルギー側にシフトする。

③ $0.3 \le d \le 2.0$ の膜厚の領域では、Sm³⁺ $3d_{5/2}$ 準位線の形状の膜厚依存性が 16K と室温とで 全く異なっており、室温から 16K に降温するに 伴い次の傾向を示す: (a) 0.7nm 厚の Sm 薄膜 では、Sm³⁺ $3d_{5/2}$ 準位線の重みが Sm²⁺ の重みに 比して大きく減少すると同時に、ピーク位置が c 点から c と b の 中間の点に移動する。(b) 0.3nm 厚の Sm 薄膜では、0.7nmの薄膜とは対 照的に Sm³⁺ $3d_{5/2}$ 準位線の重みが Sm²⁺ の重み に比して増加すると同時に、ピーク位置が b よ りの点から c 点に移動する。

これらの結果について多重項構造、遷移確率を考 慮して定性的に考察する。一般に、不完全殻を持つ 希土類金属元素の内殻準位光電子スペクトルを再現 する多重項構造や遷移確率の情報から、内殻正孔と 不対電子との相互作用を通して、価電子や不対電子 の状態を調べることができる。

まず①を考察する。2.0nm 以上の膜厚においては、 温度の高低に関係なく互いのスペクトル形状の差異 が小さい。このことと、次に厚い膜厚が1.5nmと 0.5nm 減少し、両者の隙間を埋めるデータがないこ と、光電子の脱出深度がせいぜい Inm 程度であるこ とを考慮すれば、Sm/Fe 薄膜試料の界面において は、Sm-Fe間の相互作用が、大きくても境界から0.5 ~1nm までしか及ばないことを示唆しているよう に見える。Sm/Fe(100)の4f 電子光電子スペクトル (の主多重構造線 51) に結合エネルギーのシフトが 観測されている⁹。この研究では結合エネルギーは 膜厚の増加と共に2原子層(約0.6nm)まで低結合エ ネルギー側にシフトし、その後ほぼ一定値を示す。 この研究でシフト量が大きく変化する膜厚領域は0 -0.6nm であるので、本研究の結果と矛盾するところ はなく、何らかの相互作用の存在を示唆しているの は両者共通している。

②と③について考察する。最初に結合エネルギー に注目する。Sm³⁺ 3 $d_{5/2}$ 準位線の重みが膜厚の減少 と共に一旦高結合エネルギー側に移動し、0.7nm で 最大になり、その後低結合エネルギー側にシフトす る、室温での結果は、Sm/Fe(100)の4f準位の主多 重構造線⁵I⁹と逆の傾向を示す一方で、液体窒素温



図3 16K と室温における Sm 3*d* XPS スペクトルの比較。Sm²⁺ 3*d*_{5/2} 準位線のピークを強度の基準にしている。(a) Sm(0.7nm)/Fe(10.0nm)のスペクトル。(b) Sm(0.3nm)/Fe(10.0nm)のスペクトル。

度 で の Sm/A1(001)⁵⁾ 及 び Sm/Cu(001)⁶⁾の Sm³⁺ $3d_{5/2}$ 準位線と同様の傾向を示す。他方、膜厚の 減少に伴い、単調に高結合エネルギー側に移動する 16Kの結果は、むしろ室温のSm/Fe(100)の4f準 位の主多重構造線⁵I⁹⁾と液体窒素温度での Sm/Si(001)⁸⁾の傾向と合致するように見える。

次に、Sm³⁺ 3 $d_{5/2}$ 準位線とSm²⁺準位線の重みの変 化に注目する。図 3(b)が示すように、0.3nm 厚のSm 薄膜では、降温に伴ってSm³⁺ 3 $d_{5/2}$ 準位線の重みが Sm²⁺準位線の重みに比して増加する。Sm 薄膜の層 間の間隔は 0.3nm 程度とみなされている^{3),9)}。これら のことから次のことが示唆されるように見える:界 面に接している monolayer から成るSm 薄膜では、 Sm²⁺ とSm³⁺ が競合しているが、降温と共に平均価 数が増加し、3価に近付く。

一方、0.7nm 厚の Sm 薄膜では、図 3(a) に見られる ように、Sm³⁺ 3 $d_{5/2}$ 準位線の重みがSm²⁺の重みに 比して大きく減少する。これから、0.3nm 厚の場合と は逆に降温と共に平均価数が減少することが示唆さ れる。厚み 0.7nm は 2 層強に相当しているので、こ の場合の Sm 薄膜は、Fe との界面と表面との 2 層か ら成るとみなしても大きな相違はないであろうが、 各層ごとの価数の温度依存性について推測すること は現在困難である。

Sm/Fe(100)における室温での4d → 4f 共鳴 Sm4f PESから、1 monolayer まではSm³⁺が支配 的であるとの報告⁹⁰がある。一方で、Sm 3d PESか ら液体窒素温度でのSm/Cu(001)では1 monolayer が形成されるに従ってSmの価数が2から2.7に増 加するとの報告⁶⁰がある。Sm 原子は2価(4f⁶6s² 配 置)であるが、金属状態ではSmは4f 準位から伝導 帯1電子を放出し、3価(4f⁵(5d6s)³ 配置)をとり、 Sm 金属は反強磁性を示し14K、106K にネール点を 持つことが知られている。しかし、金属内での2価 と3価の電子配置は非常に接近したエネルギーを 持っている。固体表面ではSm 原子の配位数が減少

するため、Sm 固体表面の Sm 原子は2価の配位をと ると説明されている¹¹⁾。monolayerのSm/(金属)で は、Sm 原子は表面層内の他の Sm 原子と 2 次元的、 下地の原子と半空間的な相互作用を持つ可能性があ るため、このような層内の Sm の価数の値は広い範 囲の変動を示すと推測される。実際、アニーリング 処理の有無の Sm/Al(001) monolayer の Sm 3d XPS から、秩序状態 (ordered) と 無 秩序状態 (disordered)の間には Sm の価数に大きな差異が 存在することが示された5)。逆に、この現象を利用 すれば価数の制御を行い、新しいタイプのデバイス の開発が可能になるものと期待される。本研究では、 多層膜の電子状態の基礎的知見を得るため磁性多層 膜の前処理法¹⁾に従った前処理を行ったが、キャラ クタリゼーションが未実行の試料から得たデータ²⁾ を用いた。望んだ価数の Sm 層を得るためには、多様 な前処理法を試み、キャラクタリゼーションを欠か さないことが必要である。

参考文献

- M. Ota, M. Itou, Y. Sakurai, A. Koizumi and H. Sakurai : Appl. Phys. Lett. 96, 152505 (2010)
- 2) 飯島千尋,奥沢 誠:群馬大学教育学部紀要 自然科 学編 第 58 巻 45 (2010)
- G.K. Wertheim and G. Crecelius: Phys. Rev. Lett 40, 813 (1978)
- 4) Å. Fäldt and H.P. Myers : Phys. Rev. B 34, 6675 (1986)
- 5) Å. Fäldt and H.P. Myers: Phys. Rev. B 30, 5481 (1984)
- Å. Fäldt and H.P. Myers: Phys. Rev. Lett 52, 1315 (1984)
- A. Stenborg, O. Björneholm, A. Nilsson, and N. Mårtensson: Phys. Rev. B 40, 5916 (1989)
- 8) Å. Fäldt and H.P. Myers: Phys. Rev. B 33, 1424 (1986)
- E. Vescovo, R. Rochow, T. Kachel and C. Carbone: Phys. Rev. B 46, 4788 (1992)
- 10) 例えば、A. Yamasaki *et al.*: Phys. Rev. Lett **98**, 156402 (2007)
- 11) B. Johansson: Phys. Rev. B 19, 6615 (1979)